

scia systems

scia Batch 350 для плазменно-химического осаждения из газовой фазы (PECVD)

scia Batch 350 предназначена для однородного покрытия нескольких трёхмерных подложек в одной партии. Обычно применяется для биосовместимых плёнок медицинских объектов.

scia Batch 350 использует параллельно расположенный РЧ электрод с вращением каждой подложки для однородного покрытия всех сторон. Система также доступна с дополнительным DC смещением, подаваемым на подложкодержатель.

Особенности

- Два независимо действующих противоположных РЧ электрода
- Парный или раздельный режим работы электродов
- Покрытие трёхмерных подложек в партиях
- Равномерная подача газа в область разряда с помощью "душа"
- Держатель подложки с DC смещением

Применение

- Биосовместимые плёнки для медицинских объектов (например, кардиостимулятор и стенты)



scia Batch 350

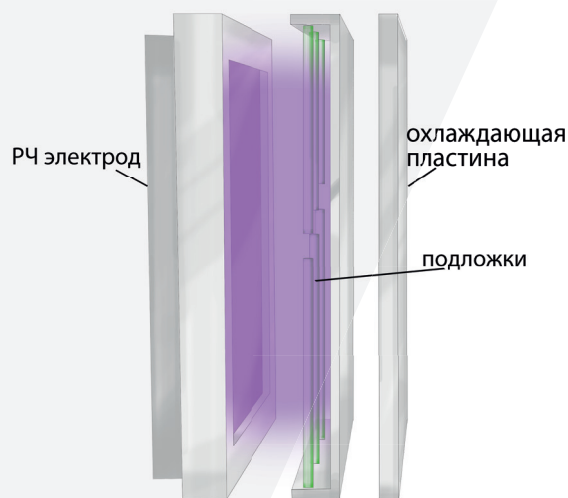
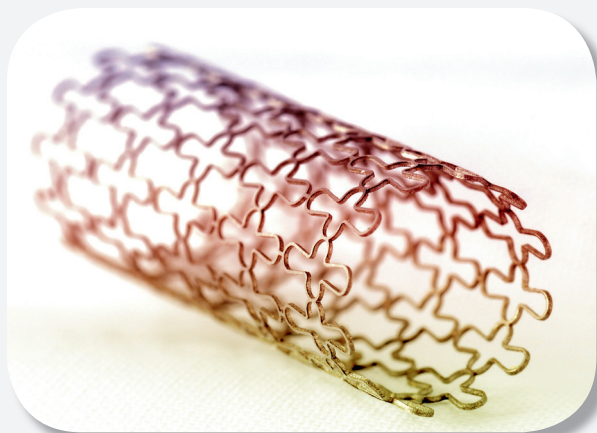


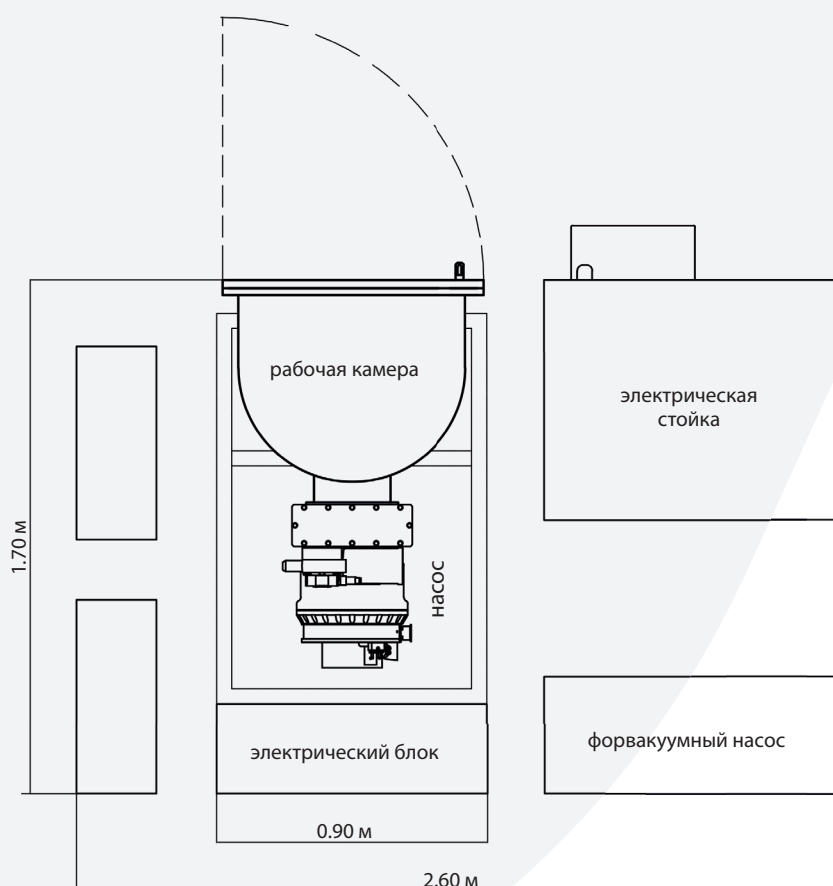
Схема scia Batch 350



Пример применения: Стен для эндоваскулярной хирургии.

Технические характеристики

Размер носителя	2 носителя с максимальным размером 350 мм x 240 мм
Держатель подложки	Водяное охлаждение, импульсное DC смещение
Источник плазмы	Параллельный РЧ электрод, 13,56 МГц
Максимальная РЧ-мощность	2 x 600 Вт
Параметры электрода	Температура: Нагрев до 400°C Расстояние: Регулируется между 50 мм и 150 мм
Режимы работы	Совместная или индивидуальная работа электродов
Типичная скорость осаждения для SiC (без смещения)	5 нм/мин
Базовое давление	$< 5 \times 10^{-7}$ мбар
Размеры системы (Ш x Г x В)	0.90 м x 1.70 м x 2.30 м (без электрической стойки и насосов)
Конфигурация инструмента	1 рабочая камера с ручной загрузкой
Интерфейс ПО	SECS II / GEM



Эскиз scia Batch 350